

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第3部門第1区分
 【発行日】平成24年1月19日(2012.1.19)

【公開番号】特開2010-116321(P2010-116321A)
 【公開日】平成22年5月27日(2010.5.27)
 【年通号数】公開・登録公報2010-021
 【出願番号】特願2010-29821(P2010-29821)
 【国際特許分類】

C 0 3 C 3/068 (2006.01)

C 0 3 B 11/00 (2006.01)

G 0 2 B 3/00 (2006.01)

【F I】

C 0 3 C 3/068

C 0 3 B 11/00 B

G 0 2 B 3/00 Z

【手続補正書】

【提出日】平成23年11月30日(2011.11.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

表面に炭素含有膜が被覆されており、アッペ数(d)が35以上40未満、転移温度(Tg)が530以上で、Li₂Oを0~0.5モル%未満含むガラスからなることを特徴とする精密プレス成形用プリフォーム。

【請求項2】

請求項1に記載の精密プレス成形用プリフォームを加熱し、プレス成形型を使用して精密プレス成形することを特徴とする光学素子の製造方法。

【請求項3】

精密プレス成形後、得られた精密プレス成形体の表面に残存する炭素含有膜を除去する請求項2に記載の光学素子の製造方法。

【請求項4】

ガラス製の精密プレス成形用プリフォームを加熱し、プレス成形型を使用して精密プレス成形体を作製する工程を含む光学素子の製造方法であって、

前記プリフォームが請求項1に記載の精密プレス成形用プリフォームであること、前記プリフォームおよび/または精密プレス成形体を炭素化合物を含む雰囲気中で熱処理すること、および前記熱処理温度が前記ガラスの転移温度(Tg)より50低い温度よりも高いこと

を特徴とする光学素子の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

すなわち、本発明は、

(1) 表面に炭素含有膜が被覆されており、アッペ数 (d) が 35 以上 40 未満、転移温度 (T_g) が 530 以上で、 Li_2O を 0 ~ 0.5 モル% 未満含むガラスからなることを特徴とする精密プレス成形用プリフォーム、

(2) 上記 (1) に記載の精密プレス成形用プリフォームを加熱し、プレス成形型を使用して精密プレス成形することを特徴とする光学素子の製造方法。

(3) 精密プレス成形後、得られた精密プレス成形体の表面に残存する炭素含有膜を除去する上記 (2) に記載の光学素子の製造方法、および

(4) ガラス製の精密プレス成形用プリフォームを加熱し、プレス成形型を使用して精密プレス成形体を作製する工程を含む光学素子の製造方法であって、

前記プリフォームが上記 (1) に記載の精密プレス成形用プリフォームであること、前記プリフォームおよび/または精密プレス成形体を炭素化合物を含む雰囲気中で熱処理すること、および前記熱処理温度が前記ガラスの転移温度 (T_g) より 50 低い温度よりも高いこと

を特徴とする光学素子の製造方法、

を提供するものである。